



## Guide d'ondes analysé par PIXE en mode Kossel

Philippe Jonnard, Jiaping Zhang, Karine Le Guen, Renaud Delaunay, Ian Vickridge, Emrick Briand, Didier Schmaus

### ► To cite this version:

Philippe Jonnard, Jiaping Zhang, Karine Le Guen, Renaud Delaunay, Ian Vickridge, et al.. Guide d'ondes analysé par PIXE en mode Kossel. JSI 2020 Journées Surfaces & Interfaces, Jan 2020, Paris, France. . hal-03932801

HAL Id: hal-03932801

<https://hal.science/hal-03932801v1>

Submitted on 10 Jan 2023

**HAL** is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



Distributed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

# Guide d'ondes analysé par PIXE en mode Kossel

P. Jonnard<sup>1</sup>, J.-P. Zhang<sup>1,2</sup>, K. Le Guen<sup>1</sup>, R. Delaunay<sup>1</sup>, I. Vickridge<sup>3</sup>, E. Briand<sup>3</sup> et D. Schmaus<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Sorbonne Université, CNRS UMR 7614, Laboratoire de Chimie Physique - Matière et Rayonnement, 4 place Jussieu, F-75252 Paris cedex 05, France

<sup>2</sup> State Key Laboratory of Solidification Processing, Shaanxi Key Laboratory of Fiber Reinforced Light-Weight Composites, Northwestern Polytechnical University, Xi'an 710072, China

<sup>3</sup> Sorbonne Université, CNRS UMR 7588, Institut des NanoSciences de Paris, 4 place Jussieu, F-75252 Paris cedex 05, France

## Diffraction de Kossel

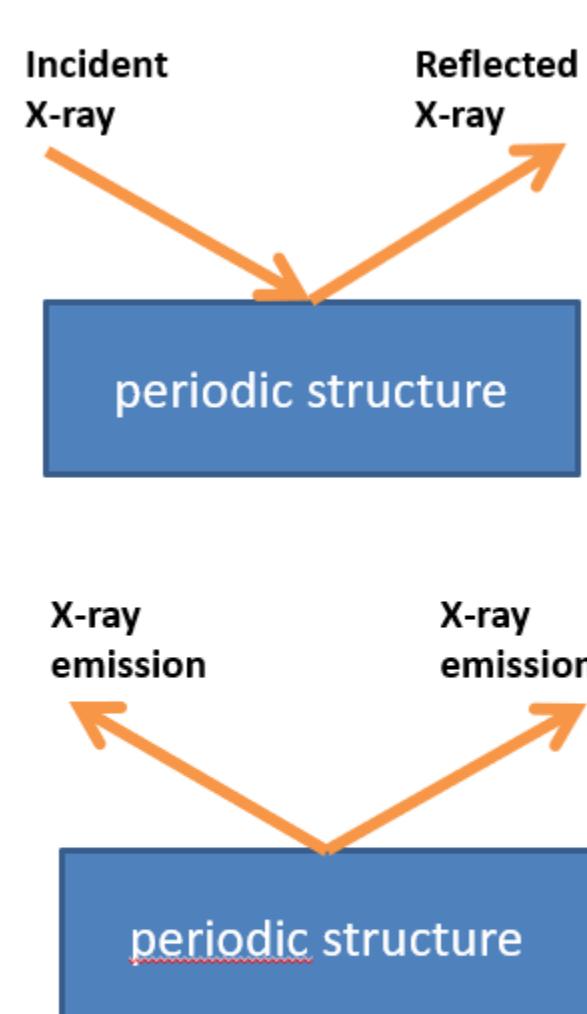
- Ondes stationnaires

Interférences entre photons des faisceau incident et réfléchi  
Ionisation par photons (XRF)

### Diffraction de Kossel

Diffraction des faisceaux émis par la structure elle-même  
Ionisation par photons (XRF), électrons (XES) ou ions (PIXE)

### Etude des guides d'ondes en mode Kossel



## Echantillon / expérience

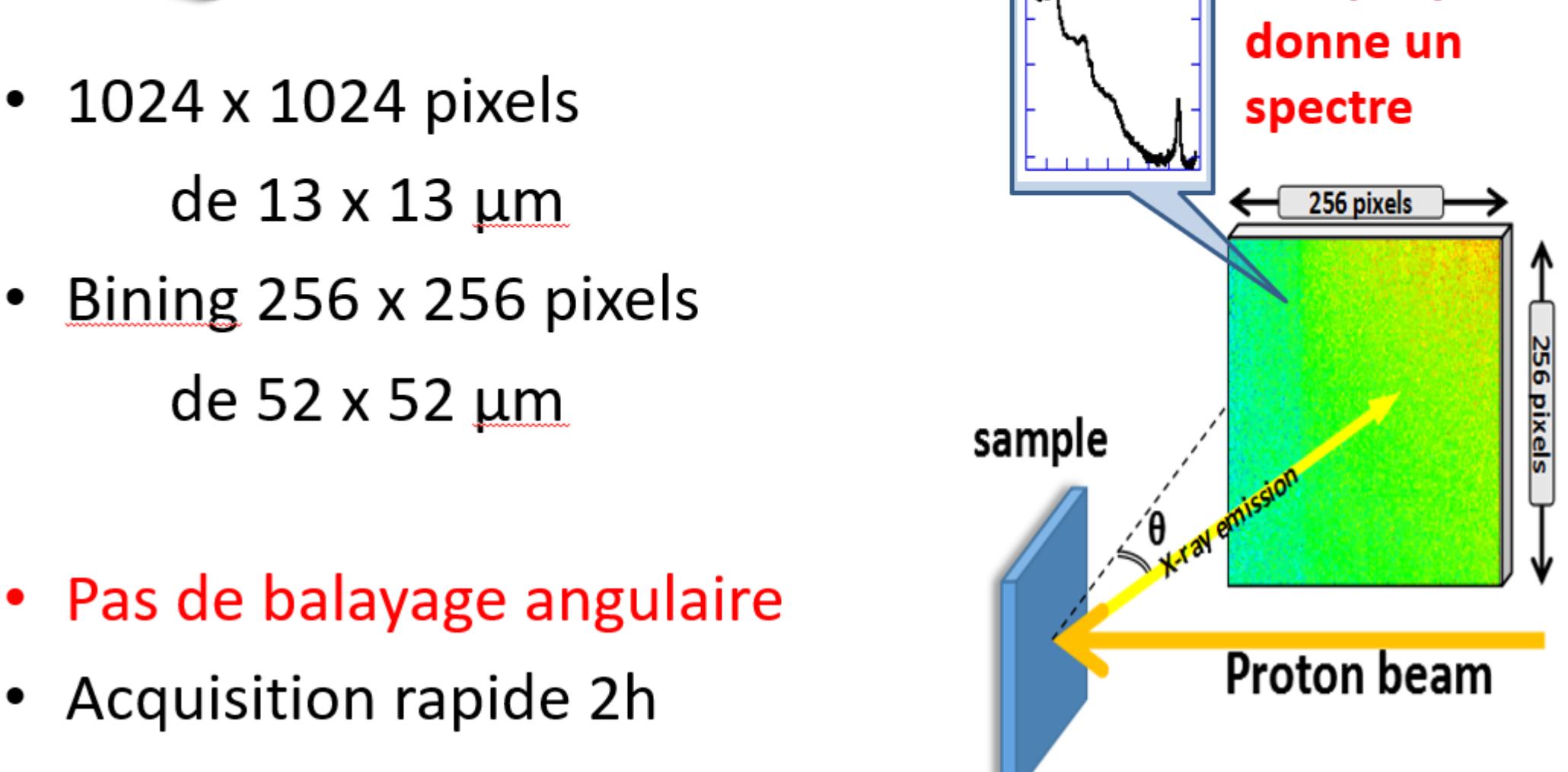
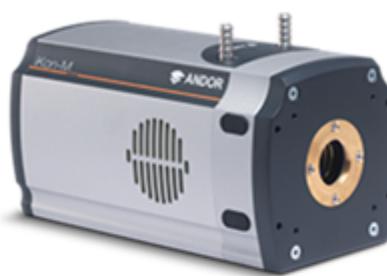
- Pt (4 nm) / Fe (6 nm) / Pt (10 nm) / substrat Si
- Dépôt par pulvérisation magnétron
- Plateforme SAFIR (Système d'Analyse par Faisceaux d'Ions Rapides), accélérateur Van de Graaf
- Prottons de 2 MeV, courant 100 - 150 nA, taille du faisceau ~ 2mm
- Ionisation uniforme en profondeur des couches Fe et Pt K



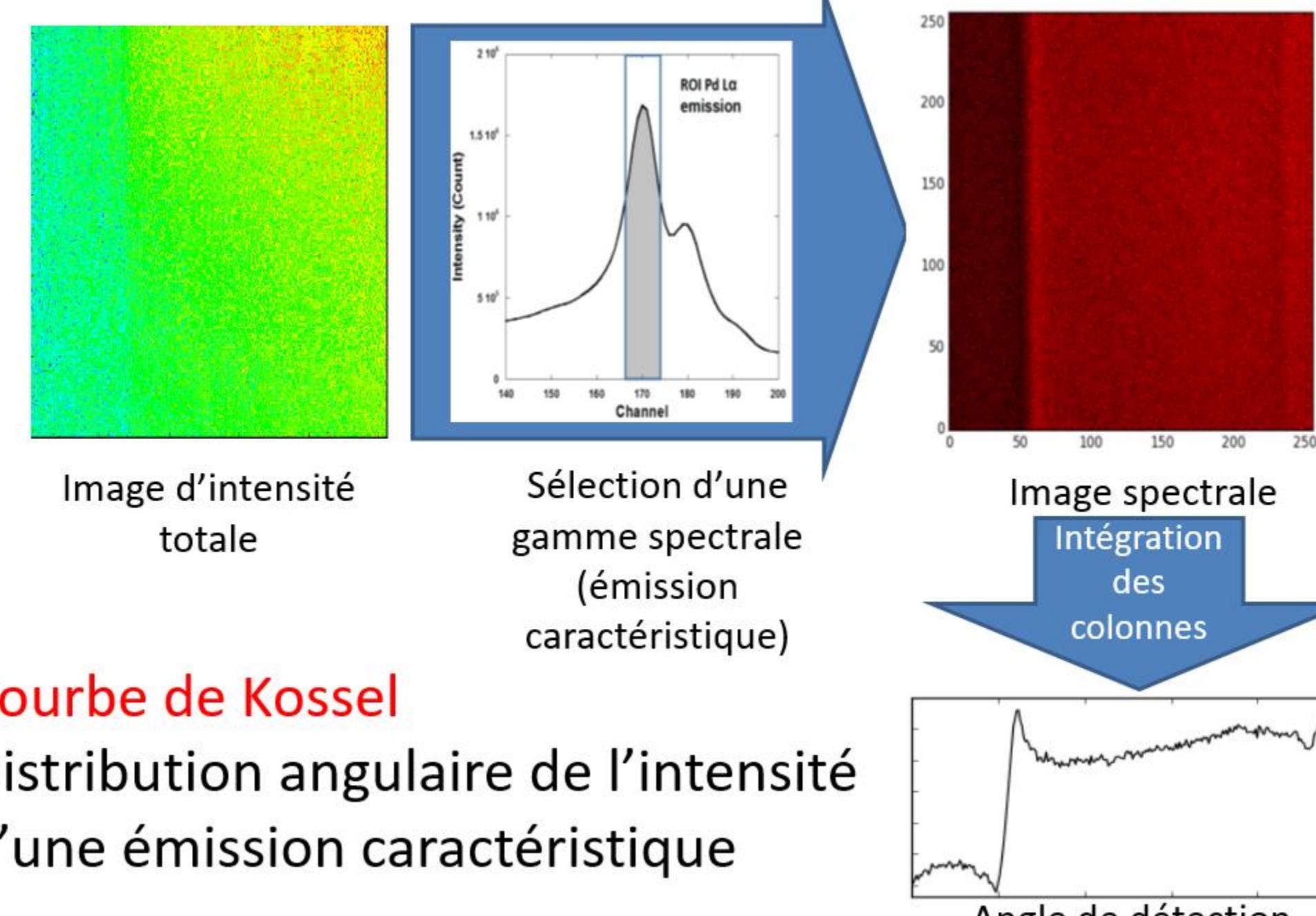
## Procédure expérimentale

Caméra CCD à sélection en énergie  
~150 eV resolution @ 5.4 keV

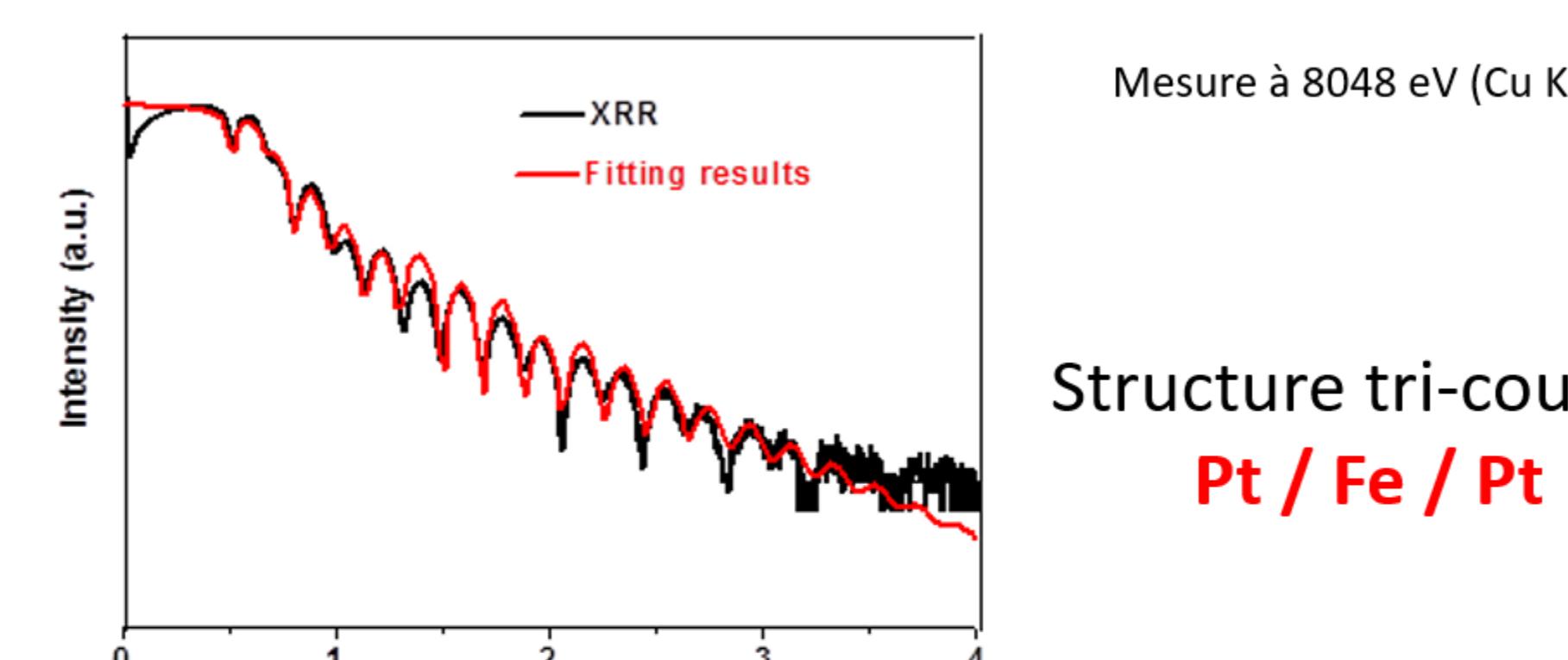
- 1024 x 1024 pixels de 13 x 13 µm
- Bining 256 x 256 pixels de 52 x 52 µm
- Pas de balayage angulaire
- Acquisition rapide 2h



## Procédure expérimentale



## Mesure de réflectivité

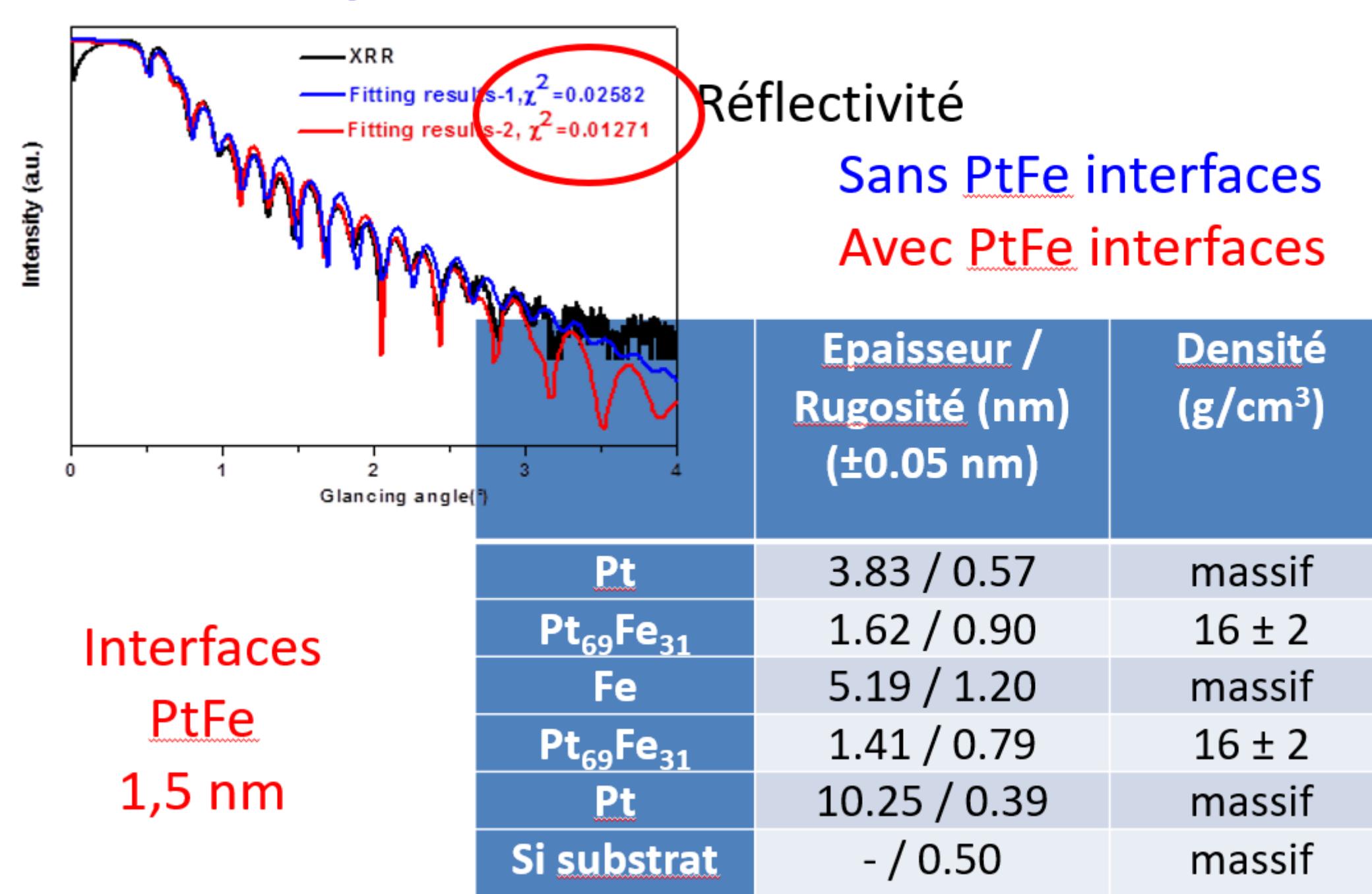


Mesure à 8048 eV (Cu Ka)

Structure tri-couche  
Pt / Fe / Pt

	Epaisseur / Rugosité (nm) (±0.05 nm)	Densité
Pt	4.62 / 0.60	massif
Fe	6.65 / 0.80	massif
Pt	11.06 / 0.77	massif
Si substrat	- / 0.42	massif

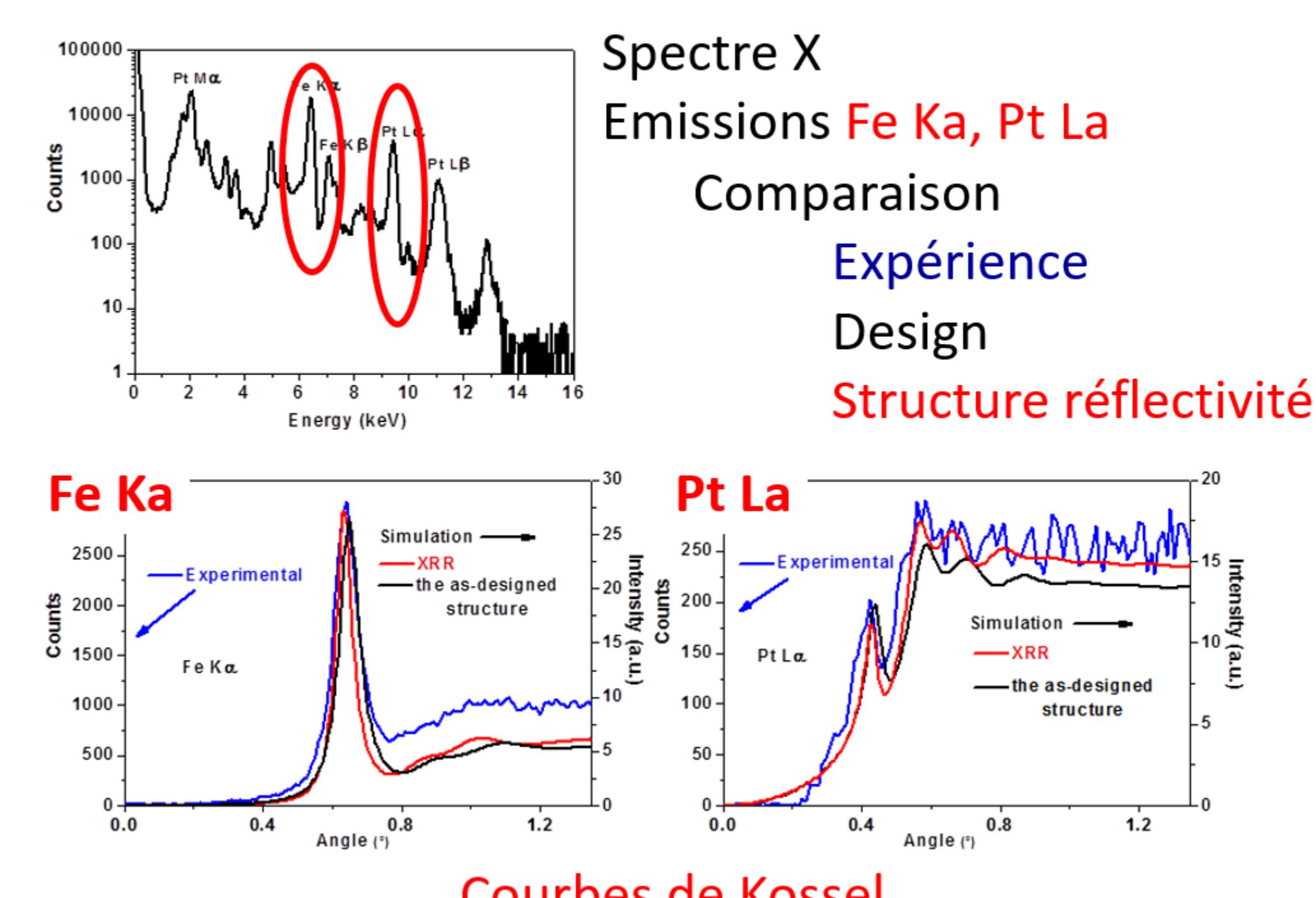
## Expériences - simulations



Réflectivité  
Sans PtFe interfaces  
Avec PtFe interfaces

	Epaisseur / Rugosité (nm) (±0.05 nm)	Densité (g/cm³)
Pt	3.83 / 0.57	massif
Pt <sub>69</sub> Fe <sub>31</sub>	1.62 / 0.90	16 ± 2
Fe	5.19 / 1.20	massif
Pt <sub>69</sub> Fe <sub>31</sub>	1.41 / 0.79	16 ± 2
Pt	10.25 / 0.39	massif
Si substrat	- / 0.50	massif

## PIXE en mode Kossel



Courbes de Kossel

## Conclusion

- Etude de guides d'ondes par PIXE en mode Kossel
- Distribution en profondeur des éléments dans des empilements de couches minces
- Reflectivité : analyse structurale
- PIXE-Kossel : analyse élémentaire
- Amélioration de la description de l'empilement
- Perspectives : analyse chimique grâce à la haute résolution spectrale

